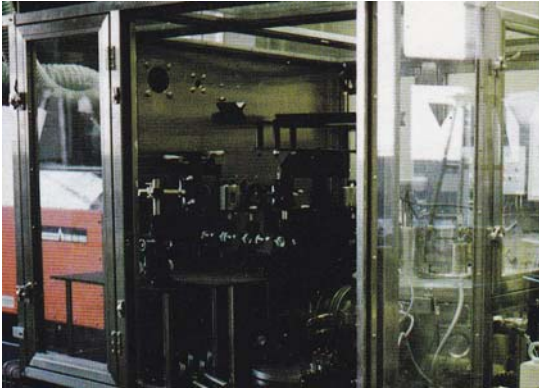


CL-12000



・特徴

<レーザーCVD>

高出力エキシマレーザーを使って、ヒーターの埋め込まれた100mm角の基板ホルダー上に成膜するレーザーCVD装置です。基板は、X-Yに連動して動かすことができます。

・仕様

膜種	C
炉体サイズ	φ440mm×600mm
炉体材質	SUS316
基板形状	4インチ 1枚
到達圧力	×10 ⁻⁴ Pa 台※常温・無負荷・脱ガス時
排気速度	×10 ⁻⁴ Pa 台迄10分以内※常温・無負荷・脱ガス時
加熱温度	600℃
圧力コントロール	自動
ガス種	CH ₄ /C ₂ H ₂ /C ₂ H ₆ /N ₂
電源	高出力レーザー
真空排気系	油回転ポンプ：375L/min メカニカルブースターポンプ：100m ³ /h
真空計	ピラニ真空計/バラトロン真空計
ユーティリティ	電気：AC200V 三相 60KVA 冷却水：50L/min 以上 0.1MPa 以上 0.15MPa 以下 25℃以下循環 計装エア：0.5MPa 以上